

J20

ION SPUTTER COATER

双靶离子溅射仪

The J20 is a dual-target ion sputter coater based on magnetron sputtering technology. Equipped with a high-performance rotary vane pump, it can quickly establish a vacuum environment below 3Pa. With its coordinated design of tilted dual-target and rotary sample stage, it deposits uniform and stable conductive coatings on sample surfaces. The system is ideally suited for (ultra-)high-resolution FE-SEM sample preparation, particularly for 3D powder samples and delicate specimens. Available sputtering materials include Au, Pt, Pd, Ir as well as Pt-Au and Pt-Pd layered alloys, etc.

J20是一款基于磁控溅射原理的双靶离子溅射仪，采用高性能旋片泵可快速建立低于3Pa的真空环境，结合倾斜双靶与旋转样品台的协同设计，可在样品表面形成均匀、稳定的导电镀层，广泛适用于（超）高分辨场发射电镜样品、特别是3D粉末类和易损伤类样品的镀层制备。可溅射金属：Au、Pt、Pd、Ir和任意组份的Pt-Au、Pt-Pd叠层合金等。

触摸屏控制，即插即用。



双靶磁控溅射
特色Pt-Au叠层配方

离子溅射仪中的SUV
样品场景通用性强

倾斜靶+旋转台设计
对3D类样品友好

SuPro Instruments LTD

速普仪器

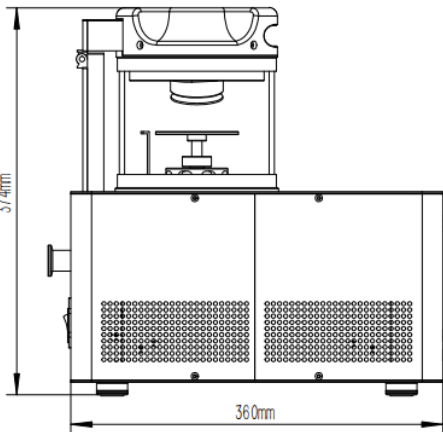
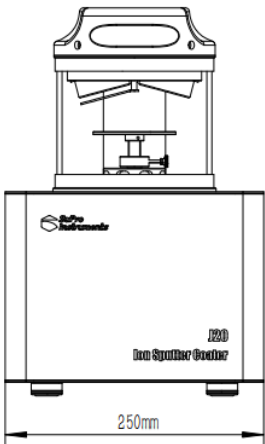
Nanshan ,
Shenzhen, China

www.suproinst.com

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
真空泵	高性能旋片泵
抽速	$\geq 4\text{m}^3/\text{h}$
极限真空	$< 1\text{Pa}$
工作气压	4 -10Pa
抽真空时间	$< 2\text{-}3\text{Min}$
真空规	皮拉尼真空计
腔室尺寸	$\sim \varnothing 150 \times 120\text{mm}$
旋转样品台	直径：80mm；转速：60RPM；靶基距：55-70mm连续可调
溅射靶材	靶材尺寸 $\varnothing 30 \times 0.2\text{-}1\text{mm}/2\text{片}$ ，支持单靶溅射和双靶顺序溅射两种模式
溅射电源	恒功率DC溅射电源 Max. 30W ， Max. 100mA， 0-800 V DC
操作方式	触摸屏控制，控制系统提供互锁保护功能
重量	主机 $\sim 15\text{kg}$
尺寸	$\sim 250\text{mm}$ 长 * 360mm 深 * 374mm 高
电源	100-240V AC， 50/60Hz 接地三脚插头
功耗	$< 500\text{ W}$
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知，如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司
 地址：深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009
 电话：0755-26642901 传真：0755-26419205
 邮件：sales@suproinst.com
 www.suproinst.com

速普仪器（太仓）有限公司
 地址：苏州市太仓健雄路大学科技园11号楼1003
 邮件：zkchang@suproinst.com
 深圳市速普仪器有限公司（北京办）
 地址：北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室